

488696-2026 - Mededinging

Ierland – Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen) –
LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4
Lots

OJ S 134/2026 15/07/2026

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling - Bericht van wijziging van een
aankondiging
Leveringen

1. Koper

1.1. Koper

Officiële naam: Education Procurement Service (EPS)

E-mail: info@educationprocurementservice.ie

Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling

Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition
Tools, 4 Lots

Beschrijving: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a
suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork.
The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the
fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS,
but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the
following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system
capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using
medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced
plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo
aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot
3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics,
advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and
controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin
films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD,
advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing
dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This
equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the
fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal
tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and
deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge
solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for
this vital component in our technological advancement.

Identificatiecode van de procedure: a024c275-b92f-48d9-83b8-52aa370660c8

Type procedure: Openbaar

De procedure wordt versneld: neen

2.1.1. Doel

Aard van het contract: Leveringen

Belangrijkste classificatie (cpv): 38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2.1.2. Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): South-East (IE052)

Land: Ierland

2.1.3. Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 3 300 000,00 EUR

2.1.4. Algemene informatie

Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

2.1.5. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Maximumaantal percelen waarop één inschrijver kan inschrijven: 4

2.1.6. Gronden voor uitsluiting

Bronnen voor uitsluitingsgronden: Aanbestedingsstuk

5. Perceel

5.1. Perceel: LOT-0001

Titel: Plasma Etcher ,Silicon ,Dielectrics

Beschrijving: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Interne identificatiecode: 1

5.1.1. Doel

Aard van het contract: Leveringen

Belangrijkste classificatie (cpv): 38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

5.1.2. Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): South-East (IE052)

Land: Ierland

5.1.3. Geraamde duur

Looptijd: 48 Maanden

5.1.5. Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Algemene informatie

Voorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

5.1.7. Strategische aanbestedingen

Doel van strategische aanbestedingen: Geen strategische aanbesteding

5.1.9. Selectiecriteria

Bronnen van selectiecriteria: Aanbestedingsstuk

5.1.11. Aanbestedingsstukken

Talen waarin de aanbestedingsstukken officieel beschikbaar zijn: Engels

Talen waarin de aanbestedingsstukken (of delen ervan) niet-officieel beschikbaar zijn: Engels

Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Midden-Europese tijd, West-Europese zomertijd

Adres van de aanbestedingsstukken: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist

Adres voor indiening: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Engels

Elektronische catalogus: Niet toegestaan

Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen: Toegestaan

Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)

Midden-Europese tijd, West-Europese zomertijd

Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 180 Dagen

Informatie over de openbare opening:

Openingsdatum: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Midden-Europese tijd, West-Europese zomertijd

Plaats: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Nog niet bekend

Elektronische facturering: Vereist

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15. Technieken

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

Geen dynamisch aankoopstelsel

5.1.16. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: The High Court of Ireland

Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken: Education Procurement Service (EPS)

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: The High Court of Ireland

Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Education Procurement Service (EPS)

Organisatie die inschrijvingen verwerkt: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Perceel: LOT-0002

Titel: Plasma Etcher ,Metals ,Piezoelectrics

Beschrijving: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Interne identificatiecode: 2

5.1.1. Doel

Aard van het contract: Leveringen

Belangrijkste classificatie (cpv): 38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

5.1.2. Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): South-East (IE052)

Land: Ierland

5.1.3. Geraamde duur

Looptijd: 48 Maanden

5.1.5. Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Algemene informatie

Voorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

5.1.7. Strategische aanbestedingen

Doel van strategische aanbestedingen: Geen strategische aanbesteding

5.1.9. Selectiecriteria

Bronnen van selectiecriteria: Aanbestedingsstuk

5.1.11. Aanbestedingsstukken

Talen waarin de aanbestedingsstukken officieel beschikbaar zijn: Engels

Talen waarin de aanbestedingsstukken (of delen ervan) niet-officieel beschikbaar zijn: Engels

Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Midden-Europese tijd, West-Europese zomertijd

Adres van de aanbestedingsstukken: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist

Adres voor indiening: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Engels

Elektronische catalogus: Niet toegestaan

Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen: Toegestaan

Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)

Midden-Europese tijd, West-Europese zomertijd

Duur waarin de aanbidding geldig moet blijven: 180 Dagen

Informatie over de openbare opening:

Openingsdatum: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Midden-Europese tijd, West-Europese zomertijd

Plaats: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Nog niet bekend

Elektronische facturering: Vereist

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15. Technieken

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

5.1.16. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: The High Court of Ireland

Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken: Education Procurement Service (EPS)

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: The High Court of Ireland

Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Education Procurement Service (EPS)

Organisatie die inschrijvingen verwerkt: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Perceel: LOT-0003

Titel: Plasma Etcher ,Slow and Controllable Rate ,Atomic Layer Etch for Silicon , Dielectrics

Beschrijving: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork.

The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Interne identificatiecode: 3

5.1.1. Doel

Aard van het contract: Leveringen

Belangrijkste classificatie (cpv): 38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

5.1.2. Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): South-East (IE052)

Land: Ierland

5.1.3. Geraamde duur

Looptijd: 48 Maanden

5.1.5. Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Algemene informatie

Voorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

5.1.7. Strategische aanbestedingen

Doel van strategische aanbestedingen: Geen strategische aanbesteding

5.1.9. Selectiecriteria

Bronnen van selectiecriteria: Aanbestedingsstuk

5.1.11. Aanbestedingsstukken

Talen waarin de aanbestedingsstukken officieel beschikbaar zijn: Engels

Talen waarin de aanbestedingsstukken (of delen ervan) niet-officieel beschikbaar zijn: Engels

Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Midden-Europese tijd, West-Europese zomertijd

Adres van de aanbestedingsstukken: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Voorwaarden van de aanbesteding**Voorwaarden voor indiening:**

Elektronische indiening: Vereist

Adres voor indiening: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Engels

Elektronische catalogus: Niet toegestaan

Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen: Toegestaan

Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)

Midden-Europese tijd, West-Europese zomertijd

Duur waarin de aanbidding geldig moet blijven: 180 Dagen

Informatie over de openbare opening:

Openingsdatum: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Midden-Europese tijd, West-Europese zomertijd

Plaats: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Nog niet bekend

Elektronische facturering: Vereist

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15. Technieken**Raamovereenkomst:**

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

Geen dynamisch aankoopstelsel

5.1.16. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: The High Court of Ireland

Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken: Education Procurement Service (EPS)

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: The High Court of Ireland

Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Education Procurement Service (EPS)
Organisatie die inschrijvingen verwerkt: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Perceel: LOT-0004

Titel: Plasma Deposition ,PECVD

Beschrijving: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Interne identificatiecode: 4

5.1.1. Doel

Aard van het contract: Leveringen

Belangrijkste classificatie (cpv): 38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

5.1.2. Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): South-East (IE052)

Land: Ierland

5.1.3. Geraamde duur

Looptijd: 48 Maanden

5.1.5. Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Algemene informatie

Voorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

5.1.7. Strategische aanbestedingen

Doel van strategische aanbestedingen: Geen strategische aanbesteding

5.1.9. Selectiecriteria

Bronnen van selectiecriteria: Aanbestedingsstuk

5.1.11. Aanbestedingsstukken

Talen waarin de aanbestedingsstukken officieel beschikbaar zijn: Engels

Talen waarin de aanbestedingsstukken (of delen ervan) niet-officieel beschikbaar zijn: Engels

Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Midden-Europese tijd, West-Europese zomertijd

Adres van de aanbestedingsstukken: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist

Adres voor indiening: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Engels

Elektronische catalogus: Niet toegestaan

Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen: Toegestaan

Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)

Midden-Europese tijd, West-Europese zomertijd

Duur waarin de aanbidding geldig moet blijven: 180 Dagen

Informatie over de openbare opening:

Openingsdatum: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) Midden-Europese tijd, West-Europese zomertijd

Plaats: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Nog niet bekend

Elektronische facturering: Vereist

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15. Technieken

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

Geen dynamisch aankoopstelsel

5.1.16. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: The High Court of Ireland

Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken: Education Procurement Service (EPS)

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: The High Court of Ireland

Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Education Procurement Service (EPS)

Organisatie die inschrijvingen verwerkt: Education Procurement Service (EPS)

8. Organisaties

8.1. ORG-0001

Officiële naam: Education Procurement Service (EPS)
Registratienummer: IE 6609370 G
Postadres: Castletroy Limerick
Stad: Limerick
Postcode: V94 DK53
Onderverdeling land (NUTS): Mid-West (IE051)
Land: Ierland
E-mail: info@educationprocurementservice.ie
Telefoon: 000
Internetadres: <https://www.educationprocurementservice.ie/>
Kopersprofiel: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Rollen van deze organisatie:

Koper

Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken

Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

Organisatie die inschrijvingen verwerkt

8.1. ORG-0002

Officiële naam: The High Court of Ireland
Registratienummer: The High Court of Ireland
Afdeling: The High Court of Ireland
Postadres: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7
Stad: Dublin
Postcode: D07 WDX8
Onderverdeling land (NUTS): Dublin (IE061)
Land: Ierland
E-mail: HighCourtCentralOffice@courts.ie
Telefoon: +353 1 8886000

Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures

8.1. ORG-0003

Officiële naam: European Dynamics S.A.
Registratienummer: 002024901000
Afdeling: European Dynamics S.A.
Stad: Athens
Postcode: 15125
Onderverdeling land (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)
Land: Griekenland
E-mail: eproc-esender@eurodyn.com
Telefoon: +30 2108094500

Rollen van deze organisatie:

TED eSender

10. Wijziging van een aankondiging

Versie van de eerdere aankondiging die moet worden gewijzigd

:

46fee6a2-f409-4cd6-80db-618a50fcc925-01

Voornaamste reden voor de wijziging

:

Informatie bijgewerkt

Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 7a2067c1-5ebe-49f4-b53b-0f9595ac5fa3 - 02

Type formulier: Mededinging

Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

Subtype aankondiging: 16

Verzenddatum van de aankondiging: 13/07/2026 16:03:29 (UTC+01:00) Midden-Europese tijd,
West-Europese zomertijd

Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Engels

Publicatienummer aankondiging: 488696-2026

Nummer uitgave PB S: 134/2026

Datum van bekendmaking: 15/07/2026